

2025년 2월 12일(수)-14일(금) | 강원도 하이원리조트

## Future Normal in Semiconductor

2025-02-13(목), 10:55-12:40

좌장: 추후업데이트 예정

### A. Interconnect & Package 분과

#### [TD2-A] Emerging Interconnect 2

TD2-A-1 10:55-11:10	광반도체 수명평가를 위한 고정밀 정션온도 세팅 기술 마병진, 정태희, 최성순, 김제민 한국전자기술연구원
TD2-A-2 11:10-11:25	Application of Physics-Informed Neural Networks (PINN) in Extreme Ultraviolet Lithography (EUVL) Process Simulation Sang-Kon Kim Hongik University
TD2-A-3 11:25-11:40	ALD Ru/ZnO의 공정 열처리 조건에 따른 박막 물성이 계면접착에너지에 미치는 영향 정대윤 <sup>1</sup> , 김가희 <sup>1</sup> , 김민진 <sup>1</sup> , 손예슬 <sup>2</sup> , Yuki Mori <sup>2,3</sup> , 김경현 <sup>5</sup> , 이주현 <sup>5</sup> , 변창우 <sup>5</sup> , 김수현 <sup>2,4</sup> , 박영배 <sup>1</sup> <sup>1</sup> 국립안동대학교 청정·에너지소재기술연구센터, <sup>2</sup> 울산과학기술원 반도체 소재·부품 대학원, <sup>3</sup> Chemical Materials Development Department, TANAKA Precious Metals, <sup>4</sup> 울산과학기술원 신소재공학과, <sup>5</sup> 차세대융합기술연구원 경기도 반도체혁신센터
TD2-A-4 11:40-11:55	Ultra Low-k Properties of Atomic Layer Deposited Amorphous Boron Nitride for Futuristic Inter Metal Dielectric Inkyu Sohn <sup>1</sup> , Taehoon Kim <sup>2</sup> , and Hyungjun Kim <sup>1</sup> <sup>1</sup> School of Electrical and Electronic Engineering, Yonsei University, <sup>2</sup> SAIT
TD2-A-5 11:55-12:10	A Theoretical Study of the Selective Silylation of Silicon Oxide with Dimethylaminotrimethylsilane Mi-Soo Kim, Khabib Khumaini, Hye-Lee Kim, and Won-Jun Lee Department of Nanotechnology and Advanced Materials Eng., Sejong University
초청 TD2-A-6 12:10-12:40	Advanced Amorphous Carbon Hardmasks for High-Density Semiconductor Patterning So-Yeon Lee <sup>1</sup> , Hongik Kim, Ung-Gi Kim, Sungtae Kim, and Young-Chang Joo <sup>2</sup> <sup>1</sup> Kumoh National Institute of Technology, <sup>2</sup> Seoul National University